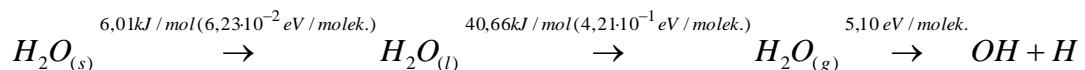


Bitne osobine plazmenog stanja

Reč „plasma“ (**πλάσμα**) je grčkog porekla i označava tvorevinu, delo. Naučnik Irvin Langmir (Irving Lanngmuir), [1] je 1928. godine plazmom nazvao svetleći, visokojonizovani deo električnog pražnjenja. Plazma se često naziva i ionizovani gas [ona sadrži pored neutralnih čestica i jone (pozitivne i ili negativne i elektrone)], mada materija u stanju plazme ima neka svojstva po kojima se bitno razlikuje od gasa. Plazma se naziva i četvrtim agregatnim stanjem a koje, u odnosu na ostala tri stanja materije, ima najveću energiju:



Na primeru molekula vode prikazali smo da je za prelaz iz čvrstog stanja u tečno, iz tečnog u gasno i dalje za procese disocijacije, jonizacije itd. potrebna određena količina energije (iznad strelica napisane su standardne entalpije prelaza).

Podsetimo se da je promena entalpije [$\Delta H=f(T)$] kao funkcija temperature, na granici faza (čvrsto-tečno stanje, tečno-gas) skokovita i izražava se vertikalnom linijom. Zagrevanje gase uz pojavu disocijacije i jonizacije njegovih molekula dovodi do naglog skoka entalpija, ali prelaz nije vertikalnan.

Plazma, sadrži, za razliku od gase i slobodne nanelektrisane čestice, elektrone, pozitivne i negativne jone i odlikuje je određeni stepen ionizovanosti (jonizacije) α , koji se kreće u širokom rasponu od 1 (kod potpuno ionizovanih plazmi kakve su termonuklearne) do slaboionizovanih kod kojih je stepen ionizovanosti α znatno manji od 1, npr. $10^{-3}, 10^{-4}$ i sl.

Navešćemo sada najvažnije karakteristike plazme:

1. Bitni činioci plazme su nanelektrisane čestice (**elektroni i joni, pozitivni i negativni**). Zato plazma predstavlja medijum kroz koji teče struja, uz postojanje lokalnih magnetnih polja i emisije elektromagnetnih talasa.
2. **Kvazineutralnost** (suma pozitivnog i negativnog nanelektrisanja u elementu zapreme je nula) je važno svojstvo plazmi. Može se izračunati da bi višak jedne vrste nanelektrisanja od 1% (na primer neka je gustina elektrona $5 \cdot 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ a višak nanelektrisanja $\Delta n = 5 \cdot 10^{17} \text{ cm}^{-3}$) doveo do nastanka električnog polja od 10^{12} V/cm , koje onda sprečava svako dalje razdvajanje nanelektrisanja. Treba naglasiti da je polje od 10^{12} V/cm vrlo električno polje; mnogo slabija polja ($1,4 \cdot 10^4 \text{ V/cm}$) iniciraju npr. tinjajuće pražnjenje.
3. Plazma u sebi sadrži **povećanu količinu energije** (entalpije) što je posledica činjenice da plazma i nastaje tako što se npr. gasu doda energija (npr. zagrevanjem).
4. Plazmu karakteriše postojanje ravnotežnih (ne uvek u kompletном obliku) ali svakako stacionarnih stanja u procesima jonizacije (stvaranja jona i elektrona) i rekombinacije (nastajanje neutralnih čestica iz nanelektrisanih), disocijacije (i njima inverznim procesima) itd.
5. Raspodela čestica po brzinama i energijama prikazuje se i u plazmi funkcijama raspodele što daje mogućnost da se plazmi pridruži određena temperatura T (koja je, kad postoji

termodinamička ravnoteža), merilo srednje kinetičke energije čestica, $\varepsilon=(3/2) kT$ (k je Boltzmanova konstanta).

Na osnovu ovih osobina plazme dolazi se i do osnova za postavljanje kriterijuma plazmenog stanja. Pri tome treba imati na umu da je:

- a. veličina plazme uslovljena srednjim slobodnim putem odnosno vremenima karakterističnih procesa.
- b. za plazmu je karakteristično i to da se ravnotežna ili stacionarna stanja uspostavljaju za kratko vreme (manje od μs) putem elastičnih i neelastičnih sudara.

Kriterijumi plazmenog stanja

Debajevo ekraniranje i relaksacioni putevi

Naelektrisane čestice u plazmi stupaju u interakciju (ona je Kulonovog tipa) jedna sa drugom pojedinačno ali i putem tzv. usrednjenog polja svih ostalih nanelektrisanih čestica. Sa druge strane potencijal pojedinačne čestice nije strogo Kulonovog tipa, dakle $\sim 1/r$, r je rastojanje. Naime oko nanelektrisane čestice određenog znaka (npr. elektrona) sakupljaju se suprotno nanelektrisane čestice formirajući sferni oblak (Debajeva sfera) određenog poluprečnika D . Ove čestice zaklanjaju (ekraniraju) česticu menjajući joj potencijal do na vrednost $\varphi \sim (1/r) e^{-r/D}$ (D je radijus Debajeve sfere, ili Debajev radijus). Iz ove relacije sledi da svako nanelektrisanje interaguje kolektivno sa nanelektrisanjima koja se nalaze unutar Debajeve sfere. Uticaj na nanelektrisanja izvan Debajeve sfere je zanemarljiv. Debajev radijus je jednak:

$$D = \left(\frac{\varepsilon_0 k T}{n_e e^2} \right)^{1/2}$$

gde je ε_0 dielektrična konstanta vakuma, k je Boltzmanova konstanta, e je elementarno nanelektrisanje, T je temperatura a n_e je gustina elektrona. Za jednu tipičnu plazmu temperature 10000 K i $n_e = 10^{16} \text{ m}^{-3}$ dobija se za $D = 6,9 \cdot 10^{-5} \text{ m}$. U inerstelarnim plazmama Debajev radijus može iznositi nekoliko metara. Dimenzija plazme L mora da bude mnogo veća od Debajevog radijusa pa je **prvi kriterijum plazmenog stanja $L \gg D$** .

Tako nam sada izgleda da se plazma sastoji iz Debajevih sfera kao nekih posebnih celina. U skladu sa time se definiše „relaksacioni put“. To je srednji put koji elektron treba da pređe pa da mu se energija kroz uzajamno dejstvo sa mikropoljem promeni za kT (srednja termalna energija). Slično se definišu i relaksaciona vremena. Relaksaciono vreme je ono vreme koje je potrebno jednom sistemu da se posle nekog poremećaja vrati u stanje ravnoteže. Poremećaji su u plazmama izazvani sudarima različite vrste. Relaksaciona vremena su kratka naročito kada su u pitanju sudari zmeđu nanelektrisanih čestica (elektron - elektron, $\tau = 10^{-12} \text{ s}$) dok su nešto duža kod sudara elektron- neutrali, $\tau = 4,1 \cdot 10^{-5} \text{ s}$.

Plazmene oscilacije

Plazme su generalno **izvori energije, različitih vrsta čestica ali i zračenja**. Plazma emituje i posebnu vrstu “sopstvenih” elektromagnetskih talasa niskih frekvencija (iz domena

radio talasa, 10^5 Hz pa do visokofrekventnog zračenja. 10^{11} Hz). Nastajanje plazmenih oscilacija koje se vezuju za Langmirove oscilacije elektrona povezano je sa očuvanjem kvazineutralnosti u plazmi. Svako slučajno pomeranje elektrona u odnosu na težu (naelektrisanu česticu) dovodi do nastanka jakog električnog polja koje vraća elektron nazad. Elektron počinje da osciluje sa Langmirovom frekvencijom ω_p :

$$\omega_p = \sqrt{\frac{n_e e^2}{m_e \epsilon_0}}$$

pri čemu je m_e masa elektrona. Ako pomnožimo Debajev radijus D i Langmirovu frekvenciju dobijamo :

$$\omega_p \times D = \sqrt{k T_e / m}$$

ili termalnu brzinu elektrona. Ovo je lako objasniti. Vreme plazmenog odgovora na izvedeni poremećaj ($1/\omega_p$) odgovara vremenu koje je potrebno elektronu koji ima termalnu energiju da pređe put D i tako ekranira poremećaj koji se dogodio.

Parametri plazme

Plazmu možemo kvantitativno okarakterisati pomoću niza parametara. Plazmeni parametri su:

temperatura (cele plazme) ili samo pojedinačnih (tipova) čestica;

konzentracija elektrona (odnosno stepen jonizacije); **Debajev radius**, relaksacioni putevi, **plazmena frekvencija**.

Spoljašnji parametri su u vezi sa karakteristikama izvora napajanja kojim se inicira plazma. Tu su **jačina struje, napon pražnjenja, električna provodljivost**. Parametri plazme su i **toplotna provodljivost i viskoznost**. Oni su tesno u vezi sa **sastavom plazme**.

Stanje plazme u datoj tački prostora u trenutku vremena okarakterisano je koncentracijama čestica (elektrona, jona, atoma, molekula i radikala) i funkcijama koje pokazuju raspodelu čestica po brzinama i po energijama. Kada je plazma u termodinamičkoj ravnoteži (koja može biti kompletna ili lokalna), njeno stanje se može opisati makroskopskim parametrom **temperaturom T** i **sastavom** plazme koji je određen termodinamičkim konstantama. Ovakve plazme nazivaju se i *termalne* (ili *netermalne*). Ravnoteža može da bude i **parcijalna** i tada se (najčešće) elektronima pripisuje jedna temperatura (veća vrednost) a težim česticama druga. U slučaju neravnoteže, stanje plazme određuju spoljašnji parametri ali i unutrašnji kao što su konstante pojedinačnih reakcija.

Elementarni procesi u plazmi

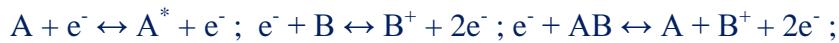
U plazmi se odvija veliki broj različitih **elementarnih procesa** – to su procesi disocijacije kao i njima inverzni procesi; ionizacije različitog tipa i inverzni procesi; eksicitacije, **zahvatanje elektrona** itd. Svi ovi procesi odvijaju se kroz elastične i neelastične sudare, karakteriše ih određena verovatnoća odnosno efikasni presek. U plazmi određenog tipa prevlađuju za nju karakteristični elementarni procesi koji dovode do uspostavljanja (dinamičke) ravnoteže odnosno stacionarnog stanja. U termalnim plazmama ili plazmama u

(lokalnoj) termodinamičkoj ravnoteži, uspostavlja se na temperaturi T stanje *dinamičke ravnoteže*, što znači da se održava **konstantnim** relativni odnos koncentracija atomskih, jonskih i molekulskih formi nastalih u u određenim hemijskim reakcijama i u procesima ionizacije odnosno rekombinacije.

Elementarni procesi mogu se klasifikovati na različite načine. **Prvi tip** elementarnih procesa predstavljaju procesi u kojima učestvuju neutralne čestice. U ovim procesima dolazi do disocijacije molekula, do pobuđivanja atoma i molekula (A^* je oznaka za atom A u pobuđenom stanju), javljaju se reakcije izmene ili asocijacije, npr.:



Dруги тип elementarnih procesa predstavljaju oni u kojima učestvuju elektroni ili joni. Ekscitacija i ionizacija atoma i molekula odvijaju se sada kroz sudare sa elektronima:



U termalnim plazmama preovlađuju procesi prvog tipa dok u netermalnim procesi drugog.

Termalna ionizacija nastaje kao rezultat termičkog kretanja molekula i atoma. Energija koja se sistemu dovodi manifestuje se kao kinetička energija prisutnih čestica. Već na temperaturi od 2000 K, kojoj odgovara srednja kinetička energija po čestici od $0,26 \text{ eV}$ ($\sim kT = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K} \cdot \text{mol} \cdot 2000 \text{ K}$), nastaje i dovoljan broj čestica (atomi, molekuli) koje imaju i znatno veću energiju (što odgovara visokoenergetskom delu Maksvelove raspodele čestica po brzinama, odnosno energijama). Ako je ta energija veća od energije ionizacije prisutnih čestica, one će se tada i ionizovati kroz. npr. procese **prvog tipa**. Nastali elektroni, dodatno ubrzavani električnim poljem, mogu takođe da vrše dalju ionizaciju. Paralelno sa procesima ionizacije dešava se, sa određenom verovatnoćom, i proces rekombinacije. U termalnim plazmama uspostavlja se stanje ravnoteže između procesa ionizacije i rekombinacije, pa se Saha-Egert jednačinom definiše stepen ionizacije α :

$$\frac{\alpha^2}{1-\alpha^2} p = \left(\frac{2\pi m_e}{h^2} \right)^{3/2} (kT)^{5/2} \exp \frac{-E_i}{kT}$$

m_e je masa elektrona, h i k su Plankova i Boltzmanova konstanta, respektivno; p je pritisak, T temperatura a E_i je energija ionizacije prisutnih atoma ili molekula. Saha jednačina je analogna dobro poznatom zakonu o dejstvu masa. U Tabeli 1 i u Tabeli 2, prikazujemo energije ionizacije nekih molekula i radikala, odnosno elektronske afinitete. Za formiranje pozitivnih jona kroz sudare elektrona i određenog atoma ili molekula, potrebni su elektroni velikih energija (jer su i energije ionizacije velike, videti Tabelu 1). Suprotno ovome za građenje negativnih jona pogodniji su elektroni manjih energija (do nekoliko elektron volti). Pozitivne vrednosti elektronskog afiniteta znače da je zahvat elektrona npr. atomom F (fluora) egzotermna reakcija (oslobadja se energija od 3,4 eV), Tabela 2.

Tabela 1. Energije ionizacije nekih atoma, molekula i radikala

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| $e^- + N_2 = N_2^+ + e^- + e^-$, | $E_i=15,6 \text{ eV}$; | $e^- + O_2 = O_2^+ + e^- + e^-$, | $E_i=12,2 \text{ eV}$. |
| $e^- + H_2 = H_2^+ + e^- + e^-$, | $E_i=15,4 \text{ eV}$; | $e^- + H = H^+ + e^- + e^-$, | $E_i=13,6 \text{ eV}$ |
| $e^- + He = He^+ + e^- + e^-$, | $E_i=24,6 \text{ eV}$; | $e^- + Ar = Ar^+ + e^- + e^-$, | $E_i=15,8 \text{ eV}$ |
| $e^- + N = N^+ + e^- + e^-$, | $E_i=14,5 \text{ eV}$; | $e^- + O = O^+ + e^- + e^-$, | $E_i=15,5 \text{ eV}$ |
| $e^- + SF_6 = SF_6^+ + e^- + e^-$, | $E_i=16,2 \text{ eV}$; | $e^- + CCl_4 = CCl_4^+ + e^- + e^-$, | $E_i=15,6 \text{ eV}$ |
| $e^- + K = K^+ + e^- + e^-$, | $E_i=4,3 \text{ eV}$; | $e^- + Ca = Ca^+ + e^- + e^-$, | $E_i=6,1 \text{ eV}$ |

Tabela 2. Elektronski afiniteti nekih atoma (EA), molekula i radikala

| | | | |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| $H^- = H + e^-$, | $EA = 0,75 \text{ eV}$; | $O^- = O + e^-$, | $EA = 1,5 \text{ eV}$ |
| $S^- = S + e^-$, | $EA = 2,1 \text{ eV}$; | $F^- = F + e^-$, | $EA = 3,4 \text{ eV}$ |
| $Cl^- = Cl + e^-$, | $EA = 3,6 \text{ eV}$; | $O_2^- = O_2 + e^-$, | $EA = 0,44 \text{ eV}$ |
| $O_3^- = O_3 + e^-$, | $EA = 2,0 \text{ eV}$; | $HO_2^- = HO_2 + e^-$, | $EA = 3,0 \text{ eV}$ |
| $F_2^- = F_2 + e^-$, | $EA = 3,1 \text{ eV}$; | $SF_5^- = SF_5 + e^-$, | $EA = 3,2 \text{ eV}$ |
| $Ca^- = Ca + e^-$; | $EA = -1,9 \text{ eV}$; | $He^- = He + e^-$, | $EA = -0,22 \text{ eV}$ |

Mehanizmi formiranja negativnih jona su sledeći:

a) Radijativni zahvat : $e^- + A = A^- + h\nu$.

b) Disocijativni zahvat : $AB + e^- \Rightarrow (AB)^- \Rightarrow A + B^-$

Ovaj zahvat se tretira kao rezonantni. Zahvatanjem elektrona molekul prelazi u neko od pobuđenih stanja molekulskog jona koji posle disosuje. Po pravilu disocijativni zahvat je endotermni proces pošto je elektronski afinitet atoma ili atomske grupe niži od energije karakteristične hemijske veze.

c) Formiranje parova je sledeći mehanizam građenja negativnih jona: $AB + e^- = A^+ + B^- + e^-$
Prag ove reakcije je visok pošto formiranje pozitivnih jona zahteva znatnu energiju.

d) zahvat s udarom tri tela: $A + B + e^- = A^- + B^-$

Ovaj zahvat je moguć u plazmama na visokim pritiscima.

Važan tip elementarnih procesa su jon–molekulske reakcije kao:



ove reakcije se de odvijaju pod uticajem ionizujućeg zračenja.

Važna vrsta elementarnih procesa su i reakcije na graničnim površinama. U ovim reakcijama učestvuju pored elektrona i pobuđene vrste, dugoživeći radikalni. Višak energije prenosi se na samu graničnu površinu kao na treće telo. Ovi procesi su tipični za **plazma-katalizu**.

Plazma kao vid električnog pražnjenja kroz gasove

Plazma se u laboratorijskim uslovima može formirati kada se uspostavi električno pražnjenje u gasu. Električno pražnjenje predstavlja u suštini protok struje kroz gas. Za protok struje neophodno je postojanje nanelektrisanih čestica koje bi se usmereno kretale u priključenom električnom polju. Gas je normalno izolator i ne provodi struju. Kada se u jednu cev sa nekim gasom (pod niskim pritiskom) unesu elektrode a između njih uspostavi napon, struja će kroz gas poteći samo onda ako u gasu postoje joni (primarni joni). Vrlo malu količinu jona stvara kosmičko zračenje (oko 20 jona na cm^3) ili radioaktivni izotopi – npr. mala količina (radioaktivnog) izotopa K^{40} koga ima u staklu od koga je napravljena cev za pražnjenje. I ta mala količina prisutnih jona bila bi, pri priključenom naponu, dovoljna za nastajanje (male) struje. Takva struja mogla bi da se održava i posredstvom spolja unesenih jona i takvo pražnjenje se naziva nesamostalno. Samostalno pražnjenje je ono koje traje nezavisno od postojanja spoljašnjeg izvora jona. Samostalnost pražnjenja ostvaruje se multipliciranjem postojećeg broja tzv. primarnih elektrona (čime se nadoknađuju gubici nanelektrisanih čestica rekombinacijom ili procesima na elektrodama). Naime, sa porastom napona uvećava se energija elektrona i jona (ako je nanelektrisanje čestice e a napon između elektroda U , tada takva nanelektrisana čestica na putu na kome vlada napon U stiče kinetičku energiju $T=eU$) pa se broj jona i elektrona umnožava jer primarni elektroni postaju sposobni da i sami vrše jonizaciju prisutnih molekula gase; novi (sekundarni) elektroni nastaju takođe i udarom pozitivnih jona o katodu. Za kratko vreme se na ovaj način stvara lavina elektrona i struja naglo raste. Preduslov za ovakav proces je da proces nastajanja jona (i elektrona) preovlađuje nad procesom rekombinacije. U slučaju nastanka lavine elektrona struja I raste po eksponencijalnom zakonu :

$$I=I_0 \exp(\alpha_T d)$$

gde je d razmak između elektroda a α_T je prvi Taunsendov koeficijent koji označava broj jonskih parova koje obrazuje jedan elektron prošavši kroz gas put jedinične dužine na putu do anode. Taunsendov koeficijent α_T zavisi od jačine električnog polja E , pritiska gase p i od prirode gase i proporcionalan je sa $\sim E/p$. Dalje nastajanje jona i elektrona se odvija i u procesima u kojima učestvuju pobuđeni molekuli, fotoni kao i pozitivni joni koji mogu da izbiju elektrone sa površine cevi za pražnjenje ili katode, kako je već pomenuto. Definisaćemo multiplikacioni faktor m :

$$m = \frac{\exp(\alpha_T d)}{1 - \gamma [\exp(\alpha_T d) - 1]}$$

γ je treći Taunsendov koeficijent koji daje prosečan broj elektrona koje sa katode izbijaju pozitivni joni. Da bi došlo do probaja u gasu ili električnog pražnjenja broj m treba da bude vrlo veliki – a to praktično znači da je $1 - \gamma (e^{\alpha_T d} - 1) = 0$ (ovo je tzv. Taunsendov kriterijum). Napon paljenja (ili probaja), U_z zavisi (slično kao Taunsendov koeficijent) od prirode gase, elektrodnog rastojanja d , pritiska gase p i to kao i proizvoda dp (Paschen-ov zakon).

Na Slici 1. prikazana je zavisnost napona od struje za različite tipove električnih pražnjenja.

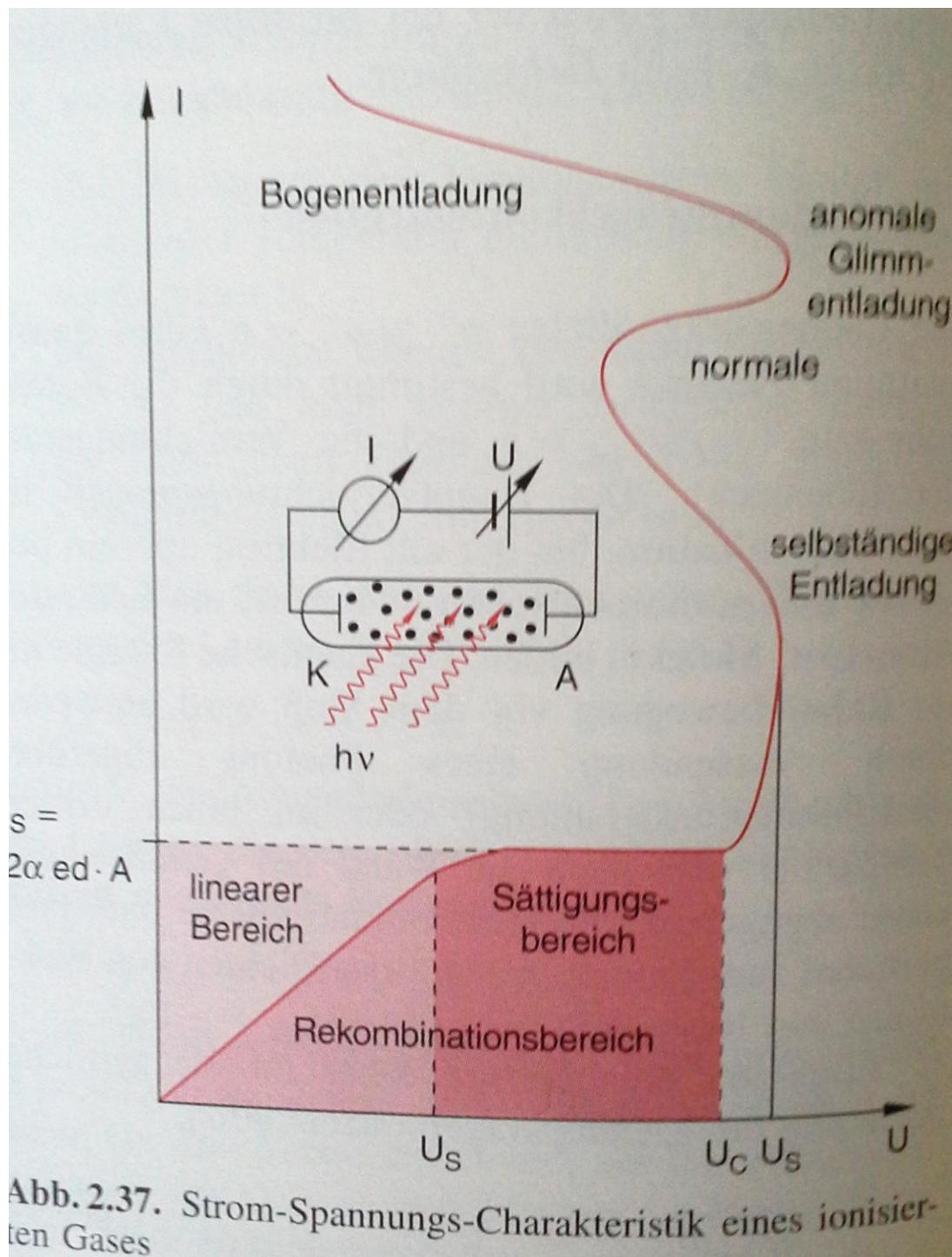
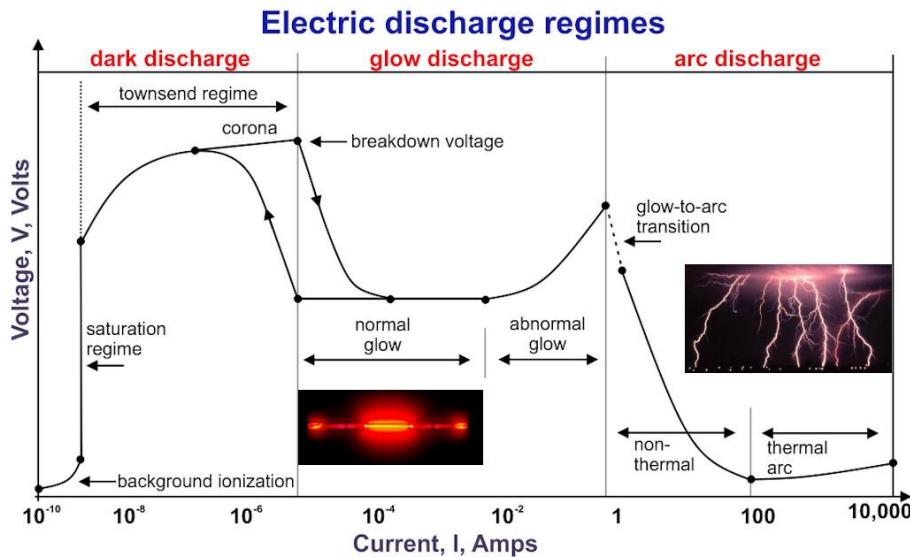


Abb. 2.37. Strom-Spannungs-Charakteristik eines ionisierten Gases

Slika 1. Zavisnost struje od napona [6]

``Obrnuti`` dijagram, tj zavisnost napona od struje, prikazujemo na Slici 2.

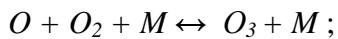


Slika 2. Zavisnost napona od struje [7]

Tipovi električnih pražnjenja

Električna pražnjenja se mogu klasifikovati na različite načine. Na osnovu volt-amperske karakteristike, Slika 2., uočili bismo postojanje četiri glavna tipa pražnjenja: Taunsendovo, korona, tinjajuće i lučna pražnjenja. Taunsendovo pražnjenje se odlikuje niskim strujama (10^{-14} do 10^{-5} A) i visokim naponom (nekoliko stotina volti).

Korona je svetlucavo pražnjenje koje se javlja u blizini zašiljenih predmeta, žica, obično na atmosferskom pritisku i pri visokim naponima (npr 30 kV). Struja je mala i zavisi od primjenjenog napona, razmaka između elektroda i oblika elektroda, vrste i pritiska gasa. I snaga je mala (0,2 W po centimetru pražnjenja). Koronasto pražnjenje je interesantan oblik pražnjenja za hemiju plazme (u ovakovom pražnjenju se bez zagrevanja formira veliki broj atoma i radikala) ali ono ima malu snagu što se donekle može popraviti povećanjem napona i struje. Samo donekle, jer sa povećanjem napona i električnog polja koronasto pražnjenje prelazi u varnično pražnjenje. Povećanje napona i snage jedne korone a bez pojave varnice moguće je korišćenjem pulsirajućeg-periodičnog (naizmeničnog) napona. Frekvencije napona variraju od 10^3 - 10^7 Hz. Korona predstavlja tip termodinamički neravnotežne plazme. Aktiviranje molekula, disocijacija, pobuđivanje vrši se sudsarima sa elektronima. Najpoznatiji vid korišćenja korone je dobijanje ozona i prestavlja jedan od prvih procesa sinteze u plazmenom reaktoru. Reakcija nastajanja ozona (O_3) iz kiseonika O_2 je endotermna reakcija ($3 O_2 \leftrightarrow 2 O_3$) – entalpija stvaranja ozona je 288 kJ/molu. Molekuli ozona nastaju u interakciji atoma kiseonika, molekula kiseonika i trećeg tela (M) :



Atomi kiseonika nastaju u reakciji: $e^- + O_2 \rightarrow O + O + e^-$. U ozonizatoru, kao početna supstanca, mogu se koristiti kiseonik (O_2) ili vazduh ili smeša CO/N₂. Na sobnoj

temperaturi dobija se stacionarna količina ozona u iznosu 10,5% a hlađenjem reakcione smeše se ovaj procenat povećava čak do 99,8% (reaktor postavljen u tečni azot).

Tinjajuće (tinjavo) pražnjenje

Tinjajuće pražnjenje je verovatno najpoznatiji oblik pražnjenja. Uspostavlja se u cevima za pražnjenje kroz gas na niskom pritisku (oko 13 Pa), pri naponu između elektroda od par stotina volti. Naziv „tinjavo“ dobilo je po svetlećoj zoni koja se stvara blizu katode a od nje je odvojena tamnim prostorom. Cev emituje svetlost skoro celom dužinom – postoje, međutim, kod katode, i tri tamne oblasti: Astonov ili prvi katodni tamni prostor (bliže katodi), drugi katodni tamni sloj koji se i naziva Kruksov (Crookes) ili Hitorfov (Hittorf) i Faradejev (Faraday) tamni prostor koji se oslanja na pozitivni stub (to je najduži prostor u cevi). Prema anodi su anodni tamni prostor i anodno svetljenje. Dakle zone tinjavog pražnjenja su (videti Sliku):

1. prvi katodni tamni prostor ili Astonov tamni prostor
2. uzani katodni svetleći sloj
3. drugi katodni tamni sloj (Kruksov ili Hitorfov)
4. širi svetleći sloj ili negativno svetlo
5. širi tamni sloj ili Faradejev tamni prostor
6. pozitivni stub (dugačak svetleći stub)
7. anodni tamni prostor
8. anodno svetljenje

Širina pomenutih slojeva tinjavog pražnjenja unutar cevi menja se sa promenom pritska gasa u cevi kao i sa promenom rastojanja između katode i anode. Sa smanjenjem pritiska gase šire se i sloj negativnog svetljenja i Faradejev tamni prostor na račun pozitivnog stuba. Pozitivni stub se takođe skraćuje i kada se skraćuje razmak između elektroda.

Za održavanje samoga pražnjenja vrlo je bitan katodni sloj i njegov pad potencijala V_c . Veza između katodnog pada potencijala, njemu odgovarajućeg električnog polja E_c i gustine struje j , može se izraziti pomoću sledećih bezdimenzionih formula:

$$\tilde{V} = \frac{\tilde{d}}{1 + \ln \tilde{d}}; \quad \tilde{E} = \frac{1}{1 + \ln \tilde{d}}; \quad \tilde{j} = \frac{1}{\tilde{d}(1 + \ln \tilde{d})^2}$$

d je debљina katodnog sloja a veličine sa talasićem iznad, su bezdimenzione.

Astonov ili prvi katodni tamni prostor ne sadrži ekscitovane molecule ili atome (zato je taman jer nema emisije svetlosti). U njemu su međutim elektroni već dovoljno ubrzani da mogu da ionizuju molekule gasa ili da izazovu disocijaciju molekula. Nastale pozitivne jone, privlači katoda, pa se pod dejstvom udara ovih jona o katodu, sa nje emituju novi elektroni. Tako se u ovoj oblasti, i na ovaj način, vrši umnožavanje elektrona. Uzani svetleći sloj naslanja se Astonov tamni prostor sa jedne strane i na **Kruksov tamni prostor** s druge, zatim sledi nešto šira svetla oblast koja se zove **Negativno svetljenje** pa **Faradejev tamni prostor**, koji svi zajedno čine deo katodne oblasti. Većina elektrona u ovim zonama (negativno svetljenje i Faradejev tamni prostor) ima prilično veliku srednju energiju a jedan vrlo mali broj elektrona ima čak i veliku (i pored toga što je električno polje u ovim zonama malo). Ovi visoko-energetski elektroni se formiraju u blizini katode i prelaze katodnu oblast trpeći mali broj neelastičnih sudara. Oni su sposobni za dalju ionizaciju i doprinose nastajanju novih elektrona pa je gustina elektrona u zoni negativnog svetljenja velika. Sporiji elektroni imaju

dovoljno energije da ekscituju molekule i atome i otuda negativno svetljenje. Poredak spektralnih linija koje nastaju deeksitacijom pobuđenih atoma, nije slučajan. Na početku zone Negativnog svetljenja su linije visokog potencijala eksitacije a na kraju zone, nižeg. U oblasti Faradejevog tamnog prostora električno polje ponovo raste i elektroni se ubrzavaju.

U pozitivnom stubu jačina električnog polja i gustina elektrona su konstantni a ukupna gustina nanelektrisanja je nula pa je pozitivni stub po definiciji u stanju plazme. Pozitivni stub je prilično dug i homogen i sa stanovišta hemije plazme je najinteresantniji deo tinajućeg pražnjenja. Stanje i parametri pozitivnog stuba su nezavisni od fenomena u katodnoj i anodnoj oblasti. Stanje plazme pozitivnog stuba je određeno lokalnim procesima formiranja i gubitka (rekombinacije) nanelektrisanih čestica, i veličinom električne struje koja se kontroliše spoljnim otporom i elektromotornom silom. Gubitak nanelektrisanih čestica prouzrokovani procesima rekombinacije u plazmi i na površini cevi se uravnovežuje, u stacionarnom stanju, ionizacijom. Joni i elektroni nastaju ionizacijom dok se gubitak nanelektrisanih čestica dešava kroz elektron-jon rekombinaciju, reakcijama zahvata elektrona od strane molekula i kroz difuziju jona do zidova cevi. U pozitivnom stubu postoje i pobuđeni atomi, i molekuli, koji zrače svetlost. Najstarija primena tinjavog pražnjenja je njegova primena kao izvora svetlosti.

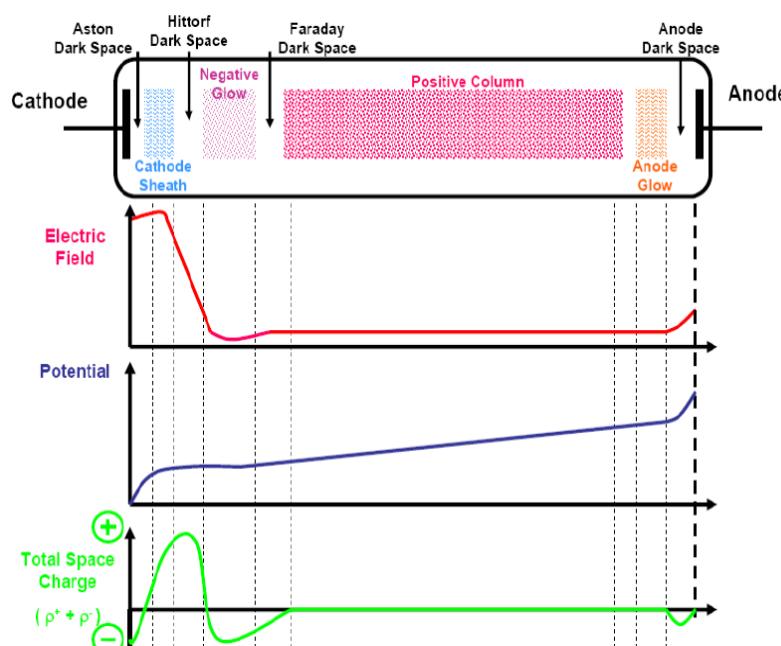
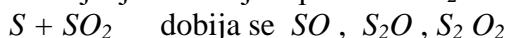
Plazma tinjavog pražnjenja je neravnovežna ili plazma u parcijalnoj termodinamičkoj ravnoteži, što bi značilo da elektroni i teže čestice imaju različite temperature. Temperatura elektrona je oko 10000 K a temperatura neutralnih čestica svega (oko) 500 K. Gustina nanelektrisanih čestica je niska oko 10^{10} po cm^3 . Pri pritisku od oko 133 Pa stepen ionizacije je 10^{-6} .

Tinjava pražnjenja mogu da se uspostave i na atmosferskom pritisku kao i pomoću visoko-frekventnih generatora napona.

Primenjuju se u procesima u kojima je potrebno izvršiti fragmentaciju većih molekula, za formiranje radikala kao i u reakcijama izomerizacije, polimerizacije. Takođe i u eliminaciji nekih grupa kod organskih molekula i u sintezi „neobičnih molekula“ odnosno radikala.

Primeri sinteze „neobičnih molekula“ pomoću tinjavog pražnjenja:

Pražnjenje se odvija u prisustvu O_2 i F_2 a dobijaju se O_3F_2 , O_4F_2 , O_5F_2 , O_6F_2 :



Slika3. Tinjavo pražnjenje [8]

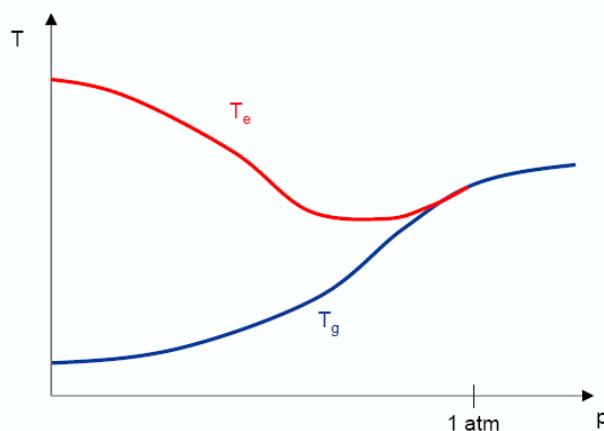
Lučna pražnjenja

Kao što su tinjava pražnjenja po pravilu netermalna i neravnotežna, lučna su po pravilu termalna odnosno u (lokalnoj) termodinamičkoj ravnoteži. Lukovi su samostalna pražnjenja jednosmerne struje, imaju relativno mali katodni pad napona, oko 10 V, koji otprilike odgovara potencijalu jonizacije (nekih) atoma. Katoda luka emituje elektrone mehanizmima termoemisije i pod uticajem električnog polja, što obezbeđuje znatnu katodnu struju, čija je vrednost bliska vrednosti struje čitavog pražnjenja. Zbog postojanja katodne struje nije potreban visoki katodni pad potencijala koji bi obezbeđivao multplikaciju elektrona (i jona) odnosno održanje pražnjenja. Lučne katode preuzimaju znatnu količinu tzv. Džulove toplove koju stvara struja pražnjenja i veoma se zagrevaju za razliku od katoda tinjajućeg pražnjenja koje su hladne. Visoka temperatura vodi, međutim, do isparavanja i erozije elektroda. Ovo je negativna osobina lučnog pražnjenja. Glavna zona pražnjenja u luku je pozitivni stub koji se nalazi između elektroda. Plazma pozitivnog stuba može biti u (lokalnoj) termodinamičkoj ravnoteži a može biti i neravnotežna, zavisno od pritiska. Lučne plazme na niskim pritiscima su neravnotežne. U Tabeli 3. su prikazani tipični parametri termalnih i netermalnih lukova.

Tabela 3. Parametri lučnih plazmi

| Parametri | Termalna lučna plazma | Netermalna lučna plazma |
|-------------------------|---|-------------------------------------|
| Pritisak gasa: | $1,013 \cdot 10^4 - 1,013 \cdot 10^7$ Pa; | $0,133$ Pa - $1,33 \cdot 10^4$ Pa |
| Struja luka: | 30 A – 30 kA; | $1 - 30$ A |
| Katodna gustina struje: | $10^4 - 10^7$ A/cm ² ; | $10^2 - 10^4$ A/cm ² |
| Napon: | $10 - 100$ V; | $10 - 100$ V |
| Snaga po dužini: | >1 kW/cm; | <1 kW/cm |
| Gustina elektrona: | $10^{15} - 10^{19}$ A/cm ² ; | $10^{14}-10^{15}$ A/cm ² |
| Temperatura gasa | $1 - 10$ eV; | $300-6000$ K |
| Elektronska temperatura | $1 - 10$ eV; | $0,2 - 2$ eV |

Kao što se vidi iz Tabele 3. lukovi koji rade pri većim pritiscima imaju i veće struje, veće gustine struje kao i energiju po jedinici dužine. Ovakvi lukovi se zovu lukovi visokog intenziteta.

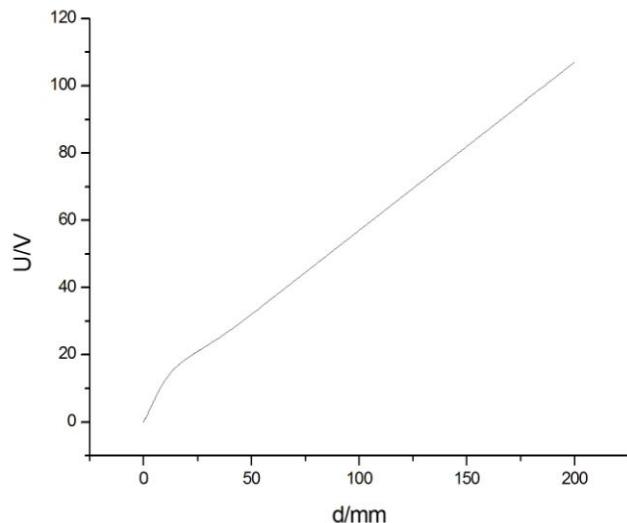


Slika 4. Zavisnost gasne i elektronske temperature od ukupnog pritiska plazme [5]

Na nižim pritiscima, temperatura elektrona ($\varepsilon^{sr}_e=kT_e$) i temperatura koja odgovara težim česticama (atomima, molekulima, tzv. gasna temperatura, T_g), se znatno razlikuju. $T_e=T_g$ na $p \geq 1$ atm.

Karakteristična za lukove je negativna voltamperska karakteristika videti i sl.1. I ova pojava je u vezi sa pojačanim oslobađanjem elektrona sa katode. Sa druge strane, postoji porast napona, pri konstantnoj stuji, kada se razmak elektroda poveća. Linearni porast ukazuje na uniformnost lučnog stuba sa konstantnim longitudinalnim električnim poljem E . Električno polje je zavisno od struje luka kao i od prirode i pritiska gasa. Električno polje je relativno malog intenziteta a i konstantno je pa je i uzrok ostvarenja termodinamičke ravnoteže – i jednakosti gustine pozitivnih i negativnih jona. To pokazuje i da je u luku brzina kretanja nosioca nanelektrisanja pod uticajem električnog polja (brzina drifta) mala, u poređenju sa termalnom brzinom (energijom) kretanja.

U lukovima na niskom pritisku, slično tinjajućem pražnjenu, ne postoji termodinamička ravnoteža ili je ona parcijalna. To znači da se temperature elektrona i težih čestica razlikuju. Naime, na niskim pritiscima energija se na teže čestice ne prenosi dovoljno efikasno; broj sudara između samih težih čestica nije veliki (zbog niskog pritiska) a sudari (elastični) sa elektronima, zbog velike razlike u masama, nisu efikasni. Sa druge strane elektroni između sebe efikasno izmenjuju energiju putem elastičnih sudara. Tako se dolazi do razlike u temperaturama između elektrona i težih čestica (atoma i molekula). Sa porastom pritiska ove razlike nestaju, sl.4. i nastaje stanje lokalne termodinamičke ravnoteže sa temperaturom od nekoliko hiljada stepeni (u Kelvinovoj skali) do desetak hiljada Kelvinovih stepeni. Najviša temperatura je u osi luka (luk može shvatiti i kao jedan cilindar, ona opada radikalno ka periferiji). Radikalni gradijent temperature zavisi od struje luka i pritiska gase. Ovaj gradijent je očigledno povezan sa gustinim slobodnog nanelektrisanja, frekvencijom sudara odnosno razmenom energije putem njih. Gustina nanelektrisanih čestica u osi luka u rasponu je vrednosti od $10^{12} - 10^{17}$ cm⁻³ a stepen jonizacije je blizu 100%. Lučne plazme su visokoenergetske plazme i odlikuju se velikom entalpijom.



Slika 5. Zavisnost napona od rastojanja između katode i anode kod industrijskih lukova (jačina struje $I=100$ A): Zhao Peng, Chin. Phys. B. 23 (2012) 064701.

Klasifikacija lučnih pražnjenja

Lukovi sa vrućom termojonskom katodom

U ovim lukovima, katoda ima temperaturu od 3000 K pa i više, obezbeđujući visoku struju termoemisijom elektrona sa katode. Luk je stacionaran i pražnjenje je ograničeno na širok katodni spot. Struja protiče kroz presek znatne širine pa njena gustina nije ekstremno velika – oko 10^2 – 10^4 A/cm². U takvим lukovima elektrode moraju biti od materijala visoke tačke topljenja (ugljenik, volfram, molibden, tantal i sl.).

Lukovi sa vrućim katodnim spotovima

Kada su katode od materijala sa nižim tačkama topljenja, temperatura katode ne može da se održava neprekidno visokom. U takvим slučajevima struja se kreće u vidu vrelog spota po površini katode. Gustina struje u spotovima je ekstremno velika – 10^4 – 10^7 A/cm². Ovo dovodi do toga se katoda intenzivno greje i isparava na maloj površini dok je ostatak katode hladan. Katodni spotovi koriste se i kod lukova nižeg pritiska kao i kod onih sa elektrodama od materijala sa visokim tačkama topljenja.

Vakuumski lukovi

To su lukovi niskog pritiska sa katodnim spotom. Atmosferu pražnjenja čini para elektrodnog materijala. Vakuumski lukovi rade u gustim metalnim parama.

Lukovi visokog pritiska

Ovi lukovi rade obično na atmosferskom pritisku ali postoje i oni koji rade pri pritisku od 10 atm. Ovakve plazme su vrlo gусте a veliki deo snage pražnjenja konvertuje se u zračenje.

Lukovi niskog pritiska

To su lukovi koji rade u uslovima nižih pritisaka gasa (133 – 0,133 Pa) i predstavljaju, kao što je već rečeno neravnotežne plazme ili plazme u parcijalnoj termodinamičkoj ravnoteži. Stepen jonizacije je u ovim lukovima znatno veći nego kod tinjajućeg pražnjenja jer su i struje mnogo veće.

Danas se koriste i različite konfiguracije lučnih pražnjenja. Najstarija varijanta je slobodno goreći linearni luk. Katoda je obično gornja elektroda a anoda donja. Postoje stabilisani lukovi: zidovima, posebnim tokom gasa ili vode. Postoje i magnetnim poljem stabilisani rotirajući lukovi. Posebnu vrstu lukova predstavlja plazmeni mlaz (plasma jet). Plazmeni mlaz predstavlja visokostrujni luk koji kroz (konusni) otvor na anodi izleće u slobodan prostor ogromnom brzinom (reda veličine brzine zvuka). Ova brzina je posledica povećanog pritiska gasa odnosno velike kinetičke energije odnosno temperature čestica plazme. Ovi plazmeni mlazevi imaju danas veliku pimenu u plazma sprej tehnikama i koriste se za naparavanje površina (npr. karbidima i nitridima bora, silicijuma itd koji se i formiraju pomoću plazme).

Plazme formirane visokofrekventnim elektromagnetskim poljima: *radiofrekventna, mikrotalasna i optička pražnjenja*

Sve plazme nastale pod uticajem visokofrekventnih polja mogu se podeliti na dve velike grupe: termalne ili kvazitermalne plazme i neravnotežne plazme. Fizička svojstva svih termalnih plazmi nastalih posredstvom visokofrekventnih polja, vrlo su slična iako su različite tehnike, pri raznim frekvencijama, korišćene za stvaranje plazme.

Konvencionalni lukovi su vezani za jednosmerne izvore napajanja, pražnjenje se uspostavlja između elektroda a cena po Watu snage je relativno niska 0,1-0,5 \$. Visokofrekventni izvori mogu da generišu plazmu tipa lučne, na visokim pritiscima i velike snage uz to i bez elektroda, što je velika prednost, jer se time izbegava zaprljanje plazme materijalom elektroda. Jedini nedostatak ovih tehnika jeste da su dosta skupe (1-5 \$/W).

Generisanje plazme induktivno-spregnutim radiofrekventnim (RF) poljem

Princip nastajanja plazme je sledeći. Visokofrekventna električna struja prolazi kroz kalem solenoida u kome se indukuje magnetno polje duž ose cevi za pražnjenje. Kao posledica se javlja visokofrekventno (vrtložno) električno polje koncentrično sa navojcima kalema koje je sposobno da ostvari proboj u gasu i uspostavi samoodrživo pražnjenje. Električne struje su u ovom pražnjenju takođe koncentrične sa navojima kalema pa je pražnjenje bezelektrodno. Nastala na ovaj način (induktivno-spregnuta) plazma može da se formira na atmosferskom kao i na višim pritiscima.

Magnetno polje u induktivno-kuplovanoj (spregnutoj) plazmi je određeno strujom solenoida; električno polje je, shodno Maksvelovim jednačinama, proporcionalno frekvenciji elektromagnetskog polja. Kao rezultat toga, frekvencija elektromagnetskog polja dovoljna da se održi plazma, treba da bude od oko 0,1 – 100 MHz. U praksi se cev za pražnjenje unosi u prostor solenoida

Interesantno je napomenuti, da snažni RF generatori mogu da stvaraju šum i da interferišu sa radio komunikacionim sistemima. Da bi se to izbeglo određene su frekvencije RF generatora plazme. Najviše se koristi frekvencija od 13,6 MHz (koja idgovara talasima dužine od 22 m).

Mikrotalasno pražnjenje

Za generisanje pražnjenja koriste se mikrotalasni generatori (magnetroni) koji rade u opsegu frekvencija od 10^9 – 10^{12} Hz. Mikrotalasni izvor se postavlja tako da omogući prolaz talasa kroz cev za pražnjenje. Pri određenoj frekvenciji uspostavlja se optimalan prenos energije i jačine električnog polja i nastaje pražnjenje u cevi.

LITERATURA

1. Irving Langmuir, Proc. Nat. Acad. Sci. 14 (1928) 627.
2. Helmut Drost, *Plasmachemie*, Akademie Verlag Berlin, 1978.
3. Božidar Milić, *Osnove fizike gasne plazme*, Građevinska knjiga, Beograd 1989.
4. Alexander Fridman, Lawrence A. Kennedy, *Plasma Physics and Engineering*, Taylor&Trancis, 2004.
5. Alexander Fridman, *Plasma Chemistry*, Cambridge University Press, 2008.
6. Wolfgang Demtröder, *Experimentalphysik*, Band 2 und 3, Springer, 1999.
7. www.plasma-universe/electric_glow_discharge
8. L.B.Loeb, Fundamental processes in electrical discharges in gases, New Yor, John Willey, Fig. 265, p 566 (1939)

